

氧化铪靶材HfO2铪靶材Hf磁控溅射靶材

产品名称	氧化铪靶材HfO2铪靶材Hf磁控溅射靶材
公司名称	北京晶迈中科材料技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:晶迈中科 型号:根据客户要求定制 产地:北京
公司地址	北京市通州区张家湾镇北大化村东(北京五木服装有限责任公司)2幢二层B2256 (注册地址)
联系电话	010-86208200 13301329625

产品详情

科研实验专用氧化铪靶材HfO2铪靶材Hf磁控溅射靶材电子束镀膜蒸发料

产品介绍

氧化铪 (HfO₂) 常温常压下为白色固体，熔点：2758 ，沸点：5400 ，密度：9.68g/cm³，难溶于水，常温常压下稳定，避免与酸接触；当加热到高温时铪与氧直接化合生成氧化铪；也可通过其硫酸盐或草酸盐经灼烧而得。用于光谱分析及催化剂体系，耐熔材料；是一种具有宽带隙和高介电常数的陶瓷材料，近来在工业界特别是微电子领域被引起极度的关注，由于它可能替代目前硅基集成电路的核心器件金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)的栅极绝缘层二氧化硅(SiO₂)，以解决目前MOSFET中传统SiO₂/Si结构的发展的尺寸极限问题。

产品参数

中文名 二氧化铪 化学式 HfO₂ 沸点 5400

分子量 210.49 熔点 2758 密度 9.68g/cm³

纯度 99.99%

铪 (Hf) 是一种带光泽的银灰色的过渡金属，具有塑性，当有杂质存在时质变硬而脆；有6种天然稳定同位素，不与水、稀盐酸、稀硫酸和强碱溶液作用，但可溶于氢氟酸和王水；空气中稳定，灼烧时仅在表面上发暗，细丝可用火柴的火焰点燃；高温下，铪也可以与氧、氮等气体直接化合，形成氧化物和氮化物。有较高的中子吸收截面，可用作反应堆的控制材料；有较高的中子吸收截面，可用作反应堆的控制材料；铪元素也用于的intel45纳米处理器。

中文名 铪 元素符号 Hf

原子量 178.49 沸点 4603

熔点 2233 密度 13.31g/cm³

支持靶材定制，请提供靶材产品的元素、比例（重量比或原子比）、规格，我们会尽快为您报价！！

服务项目：靶材成份比例、规格、纯度均可按需定制。科研单位货到付款，质量保证，售后无忧！

产品附件：发货时产品附带装箱单/质检单/产品为真空包装

交货周期：现货当天发，常规期货4周内

适用仪器：多种型号磁控溅射、热蒸发、电子束蒸发设备

质量控制：严格控制生产工艺，采用辉光放电质谱法GDMS或ICP光谱法等多种检测手段，分析杂质元素含量保证材料的高纯度与细小晶粒度；可提供质检报告。

加工流程：熔炼 提纯 锻造 机加工 检测 包装出库